Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Máquina de litografía por haz de electrones EBL B2-01-35-163-7010

Código: B2-01-35-163-7010

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones de la platina	
Equipamiento estándar	Platina con interferómetro láser
Recorrido de la platina	≤105 mm
Especificaciones del cañón de electrones y de la formación de imágenes	
Cañón de emisión de campo Schottky	Voltaje de aceleración 2OV~ 30kVDetector de electrones secundarios lateral y detector de electrones In-Lens
Resolución de imagen	≤1nm@15kV;≤1,5nm@1kV
Densidad de corriente del haz	>5300 A/cm2
Tamaño mínimo del haz	≤2 nm
Especificaciones de litografía	
Obturador del haz de electrones	Tiempo de subida < 100 ns
Campo de escritura	≤500x500 um
Ancho de línea mínimo de exposición única	10±2nm
Velocidad de barrido	25 MHz/ 50 MHz
Parámetros del generador de gráficos	
Núcleo de control	FPGA de alto rendimiento
Velocidad máxima de barrido	50 MHz
Resolución D/A	20 bits
Tamaños de campo de escritura admitidos	10 um~500 um
Compatibilidad con obturador del haz	5VTTL
Incremento mínimo del tiempo de permanencia	10ns
Formatos de archivo admitidos	GDSII, DXF, BMP, etc.
Medición de corriente del haz con copa de Faraday	Incluida
Corrección del efecto de proximidad	Opcional

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Platina con interferómetro láser	Opcional
Modos de barrido	Secuencial (tipo Z), serpentina (tipo S), espiral y otros modos de barrido vectorial
Modos de exposición	Admite calibración de campo, unión de campos, superposición y exposición automática multicapa
Compatibilidad con canales externos	admite barrido del haz de electrones, movimiento de la platina, control del obturador del haz y detección de electrones secundarios

	Platina con interferómetro láser Platina con interferómetro láser: una platina con interferómetro láser avanzada que cumple los requisitos de unión y superposición de alta precisión y gran recorrido
	Generador de gráficos Logra el dibujo de patrones de ultra alta resolución y asegura un barrido de ultra alta velocidad

B2-01-35-163-7010 VS Raith 150 Two		
Modelo del equipo	B2-01-35-163-7010 (China)	Raith 150 Two (Alemania)
Voltaje de aceleración (kV)	30	30
Diámetro mínimo del haz (nm)	2	1,6
Tamaño de platina (pulgadas)	4	4
Ancho de línea mínimo (nm)	10	8
Exactitud de unión (stitching) (nm)	50(35nm)	35
Exactitud de superposición (nm)	50(35nm)	35

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-163-7010**			
Otras especificaciones	Tiempo de alto vacío totalmente automático <2 minutos			
Accesorio opcional	B2-01-35-150-7002 EDS Espectrómetro de rayos X por dispersión de energía B2-01-35-150-7011 Recubridor iónico por pulverización catódica			
Sistemas compatibles	Win11 Win10			
Luz transmitida	Cartucho de filamento de tungsteno, voltaje 0~15KV			
Condensador	Condensador integrado, sin necesidad de ajustar manualmente la apertura (LaB6 opcional)			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Platina de trabajo	Platina XY automática, recorrido de 30x30mm, 5 ejes opcional, muestra máxima Φ50xH35mm			
Objetivo	Detector SE+BSE+CCD			
Aumento estándar	150000x			

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización